二光子吸収過程を用いたレーザによるソフトエラーシミュレーションの 焦点位置依存性の数値解析 Numerical analysis of focal position dependence of laser-based soft-error simulation employing two-photon absorption process 東大院工¹, JAXA 宇宙研² ⁰井辻 宏章^{1,2}, 小林 大輔^{1,2}, 廣瀬 和之^{1,2} Univ. Tokyo¹, ISAS/JAXA² [°]Hiroaki Itsuji^{1,2}, Daisuke Kobayashi^{1,2}, Kazuyuki Hirose^{1,2} E-mail: h.itsuji@ac.jaxa.jp, hirose@isas.jaxa.jp

[はじめに] 重イオンなどの放射線が半導体デバイスに入射すると多量のノイズ電荷(電子正孔 対)が生成される.このノイズ電荷が過渡電流となって回路中に流れ,半導体デバイスの誤動作, つまりソフトエラーが起こる.ソフトエラーが起こるか否かは過渡電流の大きさ,すなわちパル ス幅tserや収集電荷量Qcolなどにより決まる.Qcolは過渡電流を積分することで得られる.

それらの評価方法として二光子吸収型パルスレーザ照射法が用いられている[1]. それは焦点 位置にのみノイズ電荷を生成することができ、レーザのパルスエネルギーを変えることでその 量を変えることができる.これまでのところ、パルスエネルギーを一定として、デバイスの深さ 方向に焦点位置を動かしたら t_{SET} がどうなるかは詳しく調べられていない. そこで前回, Si pinフ ォトダイオードに対し、そのときの t_{SET} を測定した[2]. その結果, Q_{COL}が同じでも、異なる t_{SET} に なる場合があることがわかった.さらにその場合, p⁺層側(表面側)にノイズ電荷を生成したと きよりも、n⁺層側(裏面側)に生成したときの方が t_{SET} が長くなる傾向があった.今回、この理由 をシミュレーションで調べた.

[シミュレーション] 三次元半導体シミュレーションシステム (HyENEXSS) を用いた. 前回の 実験[2]で用いた Si pin フォトダイオードの構造を, [3], [4]をもとに作成した. すなわち, p⁺層, i層, n⁺層の不純物密度はそれぞれ 8×10¹⁸ cm⁻³, 1×10¹⁴ cm⁻³, 2×10¹⁸ cm⁻³ とした. また, 各層の厚さは それぞれ 1 μ m, 15 μ m, 334 μ m とした. この構造の内部にノイズ電荷を入力し, その位置を深さ 方向で変えながら過渡電流を計算した. 逆バイアス電圧は, 実験と同じ 10 V とした. なお, ここ で入力したノイズ電荷は, [5]に記載された式を用いて計算した. その長さは, 60 μ m 程度であっ た. その 60 μ m に渡るノイズ電荷の総量は 15 pC とした.

[結果] Fig. 1にQ_{COL}とt_{SET}の関係を示す.実験[2]と同様, t_{SET}は,電流が0.1 mA以上となる時間幅とした.実験[2]と同様, Q_{COL}が同じでも,異なるt_{SET}になる場合があることがあった. Fig. 1でQ_{COL}が同じになった,焦点位置が表面から4 µm (z = 4 µm), 16 µm (z = 16 µm)のときのポテンシャルを Fig. 2に示す.ノイズ電荷を生成してから10 ns後のポテンシャルである.あわせて定常状態のポテンシャルを示す. z = 16 µm (n⁺層側)のときのポテンシャルは, z = 4 µm (p⁺層側)のときと比べ, 定常状態のポテンシャルとの差が大きいことがわかる.このことは, n⁺層側にノイズ電荷を生成 したときの方が,ノイズ電荷が乱したi層のポテンシャルの回復時間が長いことを示唆している. これが,実験[2]で, n⁺層側(裏面側)に生成したときの方がt_{SET}が長くなった理由だと考えられる. 今後,ポテンシャルの回復時間が長くなる理由を検討する.



Fig. 1 The relationship between Q_{COL} and t_{SET} when the focal position is moved.

Fig. 2 The electric potential profile.

- [1] D. McMorrow et al., IEEE Trans. Nucl. Sci, vol. 49, no. 6, pp. 3002-3008, 2002.
- [2] 井辻 宏章, 小林 大輔, 廣瀬 和之, 第76回応用物理学会秋期学術講演会, 16a-2D-11, 2015.
- [3] S. Onoda et al., IEEE Trans. Nucl. Sci, vol. 53, no. 6, pp. 3731-3737, 2006.
- [4] J. S. Laird et al., J. Appl. Phys, vol. 98, no. 013530, 2005.
- [5] S. P. Buchner et al., IEEE Trans. Nucl. Sci, vol. 60, no. 3, p. 1857, 2013.